

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

レチクルステージはレチクルを保持して移動し、ステージコントローラはレーザ干渉系の検出結果に基づいてレチクルステージの加速度を検出し、主制御系はレチクルステージによって検出される加速度が予め求められたレチクルに位置ずれが生じないレチクルステージの加速度の範囲内となるようにレチクルステージの移動を制御し、レチクルとウエハとを同期移動しつつレチクルに形成されたパターン像を、投影光学系を介してウエハに転写する。